Cesta Per La Pulizia Di Portapiastrine In Ptfe Personalizzata, Resistente Alla Corrosione, Senza Lisciviazione, Supporto Per Esperimenti Con Polimeri Avanzati

Numero articolo: PL-CP264

introduzione

Portapiastrine in PTFE personalizzati e cestelli per la pulizia ad alte prestazioni, progettati per la ricerca su semiconduttori e polimeri. Caratterizzati da eccezionale resistenza alla corrosione e proprietà a zero lisciviazione, queste soluzioni su misura garantiscono una lavorazione senza contaminazione in ambienti chimici impegnativi per applicazioni industriali e di laboratorio ad alta precisione.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Attacco umido per semiconduttori	Contenimento di wafer di silicio durante processi di attacco acido per rimuovere ossidi o definire pattern.	L'inerzia chimica previene la contaminazione del bagno.
Analisi di tracce di metallo	Pulizia di vetreria e campioni in bagni acidi ad alta purezza per ricerche ambientali o geologiche.	La zero lisciviazione di metalli garantisce precisione analitica.
Sintesi di polimeri	Supporto di portacatalizzatori o substrati in reazioni a base di solventi ad alta temperatura.	Elevata resistenza termica e superficie antiaderente.
Fabbricazione di celle solari	Trasporto di substrati di silicio di grande formato attraverso bagni di pulizia e texturizzazione a più stadi.	Costruzione robusta per produzione ad alto volume.
Pulizia per settore farmaceutico	Sterilizzazione e pulizia di componenti delicati in vetro o metallo in soluzioni detergenti aggressive.	Conformità agli standard di alta purezza e assenza di contaminazione.
Deposizione elettrochimica	Contenimento di substrati durante placcatura o deposizione di metalli in soluzioni elettrolitiche corrosive.	Isolamento elettrico e stabilità chimica.
Lavorazione di optoelettronica	Pulizia e manipolazione di substrati in vetro o zaffiro per la produzione di LED e diodi laser.	Manipolazione senza graffi e risciacquo senza residui.
Asciugatura ad alta temperatura	Spostamento di wafer da bagni umidi direttamente in camere di asciugatura o forni riscaldati.	Mantiene l'integrità strutturale fino a 260°C.

Caratteristica	Dettagli delle specifiche (Serie PL-CP264)
Identificazione del prodotto	Portapiastrine personalizzato PL-CP264
Materiale principale	PTFE vergine ad alta purezza (PFA opzionale disponibile)
Stato di personalizzazione	100% su misura / realizzato su ordinazione
Intervallo di temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilità chimica	Universale (tutti gli acidi, basi, solventi, ad eccezione dei metalli alcalini fusi)
Configurazione delle fessure	Personalizzabile (larghezza, passo, angolo e profondità)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Caratteristica	**Dettagli delle specifiche (Serie PL-CP264)**	
Compatibilità con wafer	Dimensioni personalizzate per 1", 2", 4", 6", 8", 12" o forme non standard	
Metodo di fabbricazione	Lavorazione CNC ad alta precisione	
Finitura superficiale	Liscia, a basso attrito, non porosa	
Opzioni di maniglia	Integrata, rimovibile o interfaccia per robot	
Capacità per lotto	Progettata secondo le specifiche dell'utente (singolo o più wafer)	